

## 装置概要

MODEL GALD-55 は、有機金属の成膜装置としてⅢ-V 属系、Ⅱ-VI 属系で多数の大学、研究機関向けに納入実績があります MO-CVD 装置をベースに開発されました。

減圧下で使用可能な 110mm パイプヒーターを具備した円筒型、抵抗加熱方式の熱 CVD 装置です。本装置の原材料は、液体系 2 ラインの供給系及び Ar/N<sub>2</sub> ガスパージラインで構成されます。又、システムは原料供給系、リアクタ系、高真空系、減圧排気系、排ガス処理系、制御系により構成されます。

\* 高周波プラズマによる P-CVD 装置もご相談を承っております。